



## 電子ビーム一括描画 (rEBL) によるシームレス ローラーモールド

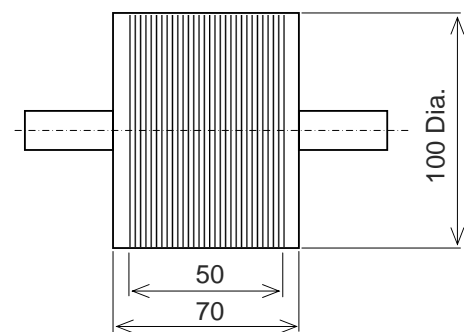
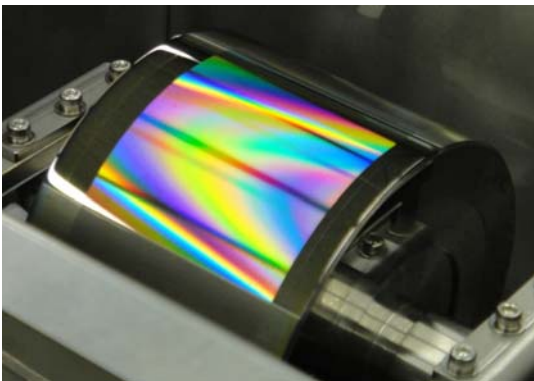
2012/5/18 第1回ナノインプリント技術研究会@品川プリンスホテル

旭化成(株) 生産技術本部

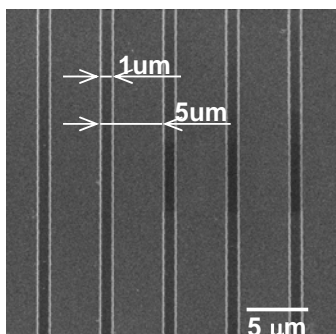
阿部 誠之

abe.mm@om.asahi-kasei.co.jp

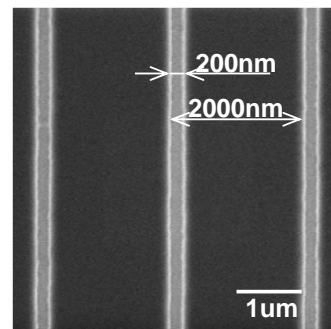
## 全面露光時レジストパターン



1um Line / 5um Space



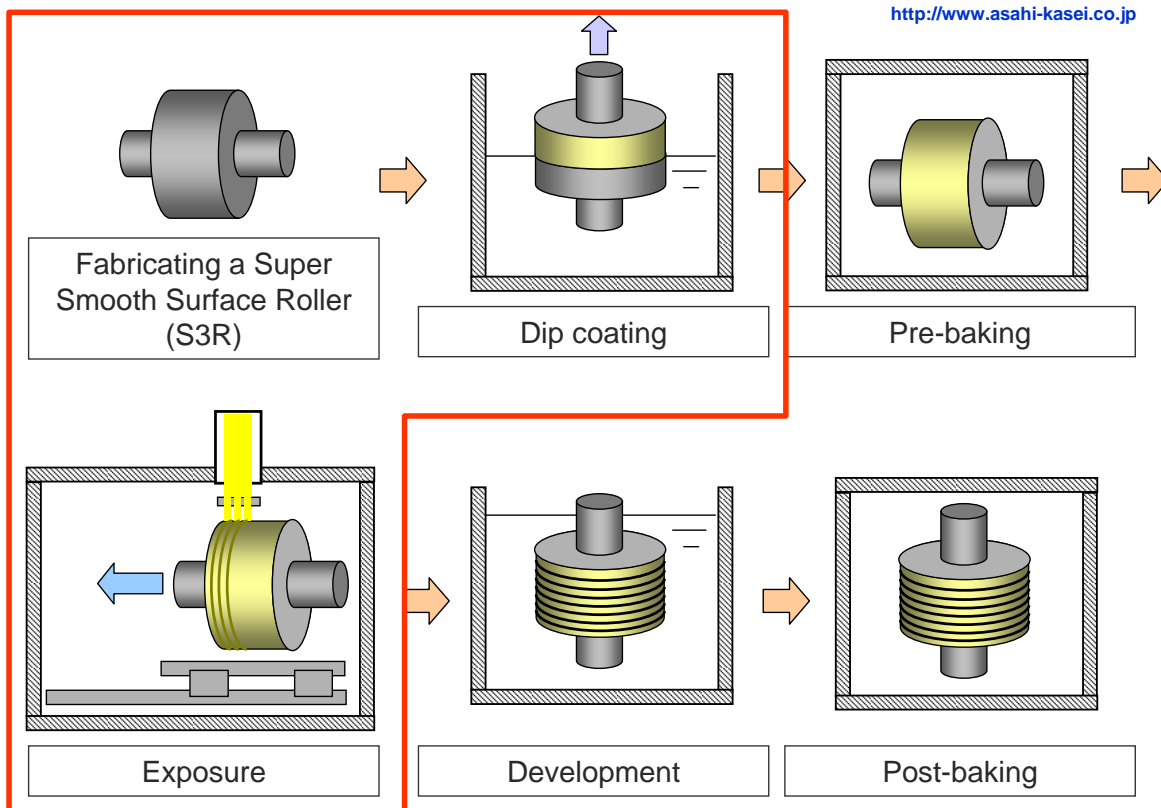
200nm Line / 2000nm Space



# rEBLプロセスによるSRM製作方法

AsahiKASEI

<http://www.asahi-kasei.co.jp>

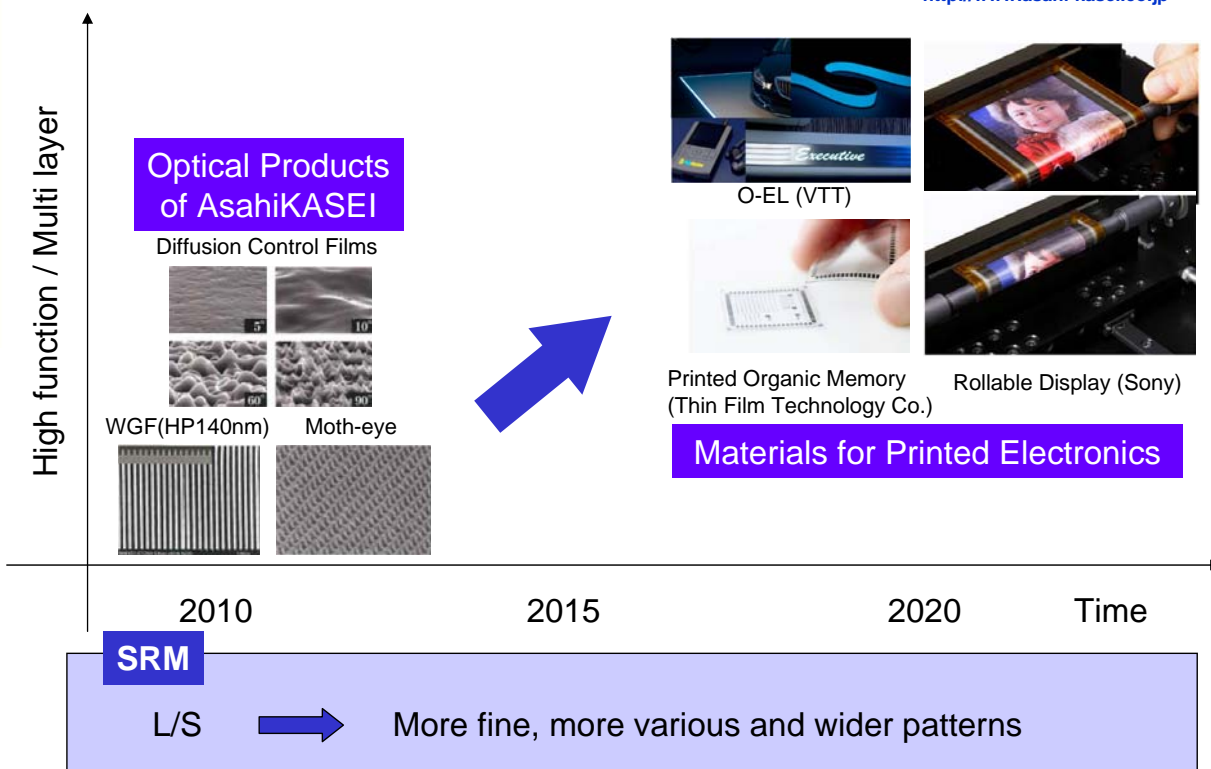


E-mail : [abe.mm@om.asahi-kasei.co.jp](mailto:abe.mm@om.asahi-kasei.co.jp)

# ロードマップ

AsahiKASEI

<http://www.asahi-kasei.co.jp>



E-mail : [abe.mm@om.asahi-kasei.co.jp](mailto:abe.mm@om.asahi-kasei.co.jp)